Design and Implementation of pulsed high current coaxial current sensor up to the order of nanoseconds

Mehrdad Jafarboland^{1*}, Behrooz Minaei², Behnam Jafarboland³

¹Faculty of Electrical Engineering and Electroseram, Malek-Ashtar University, Isfahan, Iran ²Pars Power Transmission Equipment Company, Isfahan, Iran ³Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran E-mails: jmehrdad@mut-es.ac.ir; behrooz.minaei@gmail.com; j_behnam95@yahoo.com

Short Abstract

To measure the transient current of very fast switching circuits, sensors with a high frequency bandwidth are needed. For such an accurate current sensor, the voltage measured from the two ends of the sensor conductor must be proportional to the passing current in all conditions. The main problem of these sensors is the change in the impedance of this conductor at different frequencies. In this way, the relationship between the measured voltage and the desired current is not linear and the measured value is not valid. Also, the change of conductor resistance due to skin effect can also be the cause. In this article, it is shown that based on coaxial shunt sensors and the selection of the thickness of the sensor conductors, the effect of internal conductor inductance and skin effect can be eliminated in the desired bandwidth. The conductor of the inner pipe of the sensor is divided into several parallel parts, which causes a greater increase in the ratio of ohmic resistance to inductance. Also, the inductance of this conductor has been calculated analytically. To design the sensor for the MHz frequency bandwidth and a sensor for the GHz frequency bandwidth were designed and then a sample current sensor was made. And by that, the flat current pulse with the amplitude of 146A and the width of 2.5ms and the standard current pulse of 20.8 µs with the amplitude of 2kA and the width of 32 µs have been accurately measured.

Keywords

Impulse current, skin effect, resistance shunt, coaxial shunt, manganin.

1- Short Introduction

Coaxial current sensors are one of the important measuring tools in the electrical laboratory. The feature of these sensors is the ability to measure signals with a large range up to several kiloamperes, as well as the ability to measure transient signals with a very high rate of change. The main problem is the measurement of very fast transient pulse waves. It means waves with a small rise time, ranging from microseconds to nanoseconds. Therefore, the structural parameters of this sensor, which are effective in increasing the bandwidth, should be taken into consideration.

2- Proposed Work and Methodology (including comprision, simulation/experimental results and discusion)

The inner tube was made of four parallel pieces to increase the ratio of ohmic resistance to inductance by increasing the ohmic resistance. The inductance of the parallel multi-piece tube is calculated for the first time in this article. The thickness of the tube was reduced enough to eliminate the skin effect for the desired frequency. The diameter of the inner tube is such that the ratio of inductance and resistance at the desired frequency cannot reduce the bandwidth. Also, the diameter of the outer tube is such that the capacitor between the two tubes and the resistor cannot reduce the bandwidth at the desired frequency. In addition, in the design, thermal considerations have been made for the measured pulse. The flowchart of the design steps is provided. In the laboratory test with the prototype sensor, the flat current pulse with an amplitude of 146 amps and a width of 2.5 milliseconds and a scuracy.

3- Conclusion

Using several parallel conductors instead of the internal tubular conductor of the coaxial shunt sensor can increase the ohmic resistance of the tube. This increase in resistance is effective in increasing the output voltage and reducing the effect of noise. Also, increasing the resistance makes it possible to establish the condition of relation (9) better. In this way, the bandwidth limit is reduced. The resistance and inductance of the inner tube which is divided into several pieces was calculated. An algorithm for designing the sensor based on the characteristics of the measured pulse was presented, and the results of the constructed sample confirm the correctness of the design.

4- References

[1]Omar M. O. Gatous, and J. Pissolato Filho, "A New Fomulation for Skin-effect Resistance and Internal Inductance Frequency-Dependent of a Solid Cylindrical Conductor," IEEE Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, 2004.

[2]W. Zhang, Z. Zhang, F. Wang, "Review and Bandwidth Measurement of Coaxial Shunt Resistors for Wide-Bandgap Devices Dynamic Characterization," IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 29 September - 03 October, 2019.

طراحی و ساخت سنسور جریان کواکسیال جریان زیاد پالسی تا مرتبه نانوثانیه

مهرداد جعفربلند

دانشيار، مجتمع دانشگاهی الکترومغناطيس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهينشهر، ايران

بهروز مينايى

کارشناس ارشد، شرکت تجهیزات انتقال برق پارس، اصفهان، ایران

بهنام جعفربلند

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیدہ

برای اندازه گیری جریان گذرای مدارهای باسرعت کلیدزنی بسیار سریع به حسگرهای با پهنای باند فرکانسی زیاد نیاز است. برای چنین سنسور جریان دقیقی بایستی ولتاژی که از دو سر هادی سنسور اندازه گیری میشود در همه شرایط با جریان عبوری متناسب باشد. مشکل اصلی این سنسورها، تغییر اندازه امپدانس این هادی در فرکانسهای مختلف است. به این طریق رابطه ولتاژ اندازه گیری شده با جریان مورد نظر خطی نیست و مقدار اندازه گیری شده اعتبار ندارد. همچنین تغییر مقاومت هادی بهواسطه اثر پوستی نیز می تواند مزید بر علت باشد. در این مقاله نشان داده شده که بر اساس سنسورهای شنت کواکسیال و انتخاب ضخامت هادیهای سنسور، اثر اندوکتانس هادی داخلی و اثر پوستی در پهنای باند دلخواه قابل حذف است. هادی لوله داخلی سنسور به چند قسمت موازی تقسیم شده که باعث افزایش بیشتر نسبت مقاومت اهمی به اندوکتانس میشود. همچنین اندوکتانس این هادی بصورت تحلیلی محاسبه شده است. برای طراحی سنسور بر اساس پهنای باند فرکانس و مشخصات پالس جریان، فلوچارت طراحی سنسور پیشنهاد شد و بر اساس آن یک سنسور جریان برای پهنای باند فرکانسی و MHZ و یک سنسور برای پهنای باند وکانس و مشخصات پالس جریان، فلوچارت طراحی سنسور جریان نمونه ساخته شده و توسط آن پالس مسطح جریان با دامنه ۲۶۹۵ و پهنای ۲۹۳۶ با دقت مونه ساخته شده و تی پهنای باند فرکانسی و با ۲۰ و پهنای ۲۰ و یک سنسور برای پهنای باند و جریان با دامنه ۲۶۹۶ و پهنای ۲۹ پیلس جریان استاندارد ۲۸۲۰ با دامنه ۲۸۸۲ و پهنای ۲۹ با دقت خوب اندازه گیری شده است.

كلمات كليدى

جريان ضربه، اثر پوستى، شنت مقاومتى، شنت كواكسيال، منگنين.

نام نویسنده مسئول: دکتر مهرداد جعفربلند ایمیل نویسنده مسئول: jmehrdad@mut-es.ac.ir

> تاریخ ارسال مقاله: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ تاریخ(های) اصلاح مقاله: ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

۱– مقدمه

در سیستم پالسی به پالس هایی که توان قله آن حداقل ۱۸۳۷ باشد پالس پرتوان می گویند. امروزه تکنولوژی پالس پرتوان علاوه بر کاربردهای منحصر به فرد خود به واسطه قابلیت هایی مانند مصرف انرژی کمتر، رقیب سایر تکنولوژی ها است. و به مرور کاربرد آن افزایش می یابد. تعدادی از این کاربردها عبارتند از: کاربرهای بیولوژیک، تصفیه آب و فاضلاب، بازیافت مواد، میکروب زدایی درصنایع غذایی، خرد کردن انواع سنگ، استریل کردن تجهیزات و سرمها، تصفیه هوا از فلزات سنگین، تولید ازن، تولید یون، تولید میدان الکتریکی و مغناطیسی بسیار قوی، تخریبگرهای الکترومغناطیسی، تست عایق ها، پر تابگرهای مغناطیسی، پمپ مغناطیسی، تولید پرتو لیزر، دستگاه MRI الکتروپوراسیون [۲۰۱]. برای هر یک از این کاربردها شکل ولتاژ و جریان پالس

بایستی ویژگی خاصی داشته باشد و لذا مشاهده شکل موج پالس خروجی منابع پالسی ضروری است. توان قله پالس بعضی از این کاربردها در محدوده بیش از TW و زمان خیزش پالس در محدوده rm تا rn و اخیرا rg است. آنالیز پالسها نشان میدهد پالسهای با زمان خیزش کمتر شامل مولفه های با فرکانس بالاتری است. اساس کار سنسورهای جریان زیاد بر پایه استفاده از یک المان مقاومتی کوچک و خالص است تا نمونه ولتاژ دوسر المان متناسب با افت ولتاژ اهمی باشد و با اندازه گیری ولتاژ این المان و تقسیم نمودن آن بر عدد مقاومت اهمی، جریان تعیین شود. اما در عمل وجود اندوکتانس المان، ولتاژ سلفی را بوجود میآورد که خود تابع فرکانس است و باعث خطا در محاسبه جریان میشود. به عبارتی هرچه نسبت R/L بزرگتر باشد به افزایش دقت کمک می کند. در اندازهگیریهای مختلف فرکانس متفاوت است و حتی در اکثر مولدهای پالس

پرتوان شکل دو موج متوالی آن با هم یکسان نیست و شامل فرکانس متفاوتی هستند لذا نمی توان ولتاژ سلفی که تابع فرکانس است را برآورد نمود و به ناچار باید آن را حذف و یا به میزان قابل قبول کاهش داد. همچنین عواملی مانند دما و اثر عمق پوستی نیز باعث تغییر مقاومت اهمی میشوند و دقت اندازه گیری را کاهش می دهد. البته عمق اثر پوستی نیز تابعی از فرکانس است. بنابر این لازم است اثر فرکانس در تغییر مقاومت اهمی و ایجاد افت ولتاژ اندوکتانسی حذف شود تا اندازه گیری دقیق باشد. همچنین بررسی شود که تغییر دمای المان بر اثر عبور پالس جریان در حدی نباشد که بر دقت اندازه گیری اثر بگذارد.

سنسورهای جریانی کواکسیال یکی از ابزارهای اندازهگیری مهم در آزمایشگاه برق میباشد. ویژگی این سنسورها، قابلیت اندازه گیری سیگنالهای با دامنه بزرگ تا بیش از چندین کیلو آمپر و قابلیت اندازه گیری سیگنالهای گذرا با سرعت تغییر خیلی زیاد اما محدود می باشد. مساله اصلی، اندازه گیری موجهای گذرای پالسی خیلی سریع است. منظور موجهای با زمان خیزش کوچک و از مرتبه میکرو ثانیه تا نانوثانیه است. لذا بایستی پارامترهای ساختاری این سنسور که در افزایش پهنای باند موثرند مورد توجه قرار گیرد. سیگنالهای جریان ضربه به دو دسته سیگنالهای کلیدزنی و صاعقه (برخورد مستقیم و غیرمستقیم) تقسیم میشوند. مرکز تحقیقات هولندر نشان داد که اندازه گیری موج ضربه جریان با فرکانسهای زیاد برای محدوده دامنه جریان کم دقت مناسبی دارد [۳]. واحد ابزار و اندازه گیری IEEE ، بر اساس تحلیل پارامتریک مدل شنت به تاثیر عواملی مانند هندسه و فناوری مواد بر پهنای باند می پردازد [۴]. مرجع [۵] به تاثیر جریان پوستی و میدان های آن بر پهنای باند پرداخته است. شکل موجهای ضربه جریان را با دو روش توانستهاند اندازه گیری کنند. روش اول ساختار اندازه گیری لوله کم امپدانس و روش دوم الگوی اندازه گیری حلقه است [۶]. در روش دوم باید از ولتاژ القایی انتگرال گرفت و این کار برای موج تیز از مرتبه نانو ثانیه بسیار پیچیده است. لذا طراحی و ساخت سنسور اندازهگیری جریان پالسی خیلی تیز و با دامنه زیاد همراه با چالش است; اکثراً برای آن از گزینه سنسور جریان ضربه به روش کم امپدانس استفاده شده است و تلاش شده با اصلاح مسیر جریان ضربه، اثر سلفی مزاحم در بخش اندازه گیری حذف شود. فرکانس بیشتر باعث پررنگ شدن اثر سلفی مزاحم شده و عملاً اندازه گیری پالس های خیلی تیز را محدود می کند. شانت کواکسیال یکی از تکنیکهای رایج در سنسورهای کم امپدانس است که اثر مولفه سلفی مزاحم را تقلیل میدهد. از آنجا که اندازه گیری مقاومت کمتر از ۰/۱ اهم دشوار است. در [۷] روشی برای اندازه گیری امپدانس پیچیده نسبت انتقال شنتهای جریان در باند فرکانس با استفاده از تقویت کننده قفل شونده یا همان تقویت کننده حساس به فاز با ورودی تفاضلی ارائه شده . در [۸] بر اساس الگوریتم -LCR SAFit، روشی برای اندازه گیری پارامترهای انواع مدل های شنت کواکسیال که در RLC مترها تا فرکانس ۱۰kHz بکار می وند ارائه شده است. در [۹] برخی از عوامل توليد خطا در نسبت تبديل شنت هاى كواكسيال بررسى شده و خطاى تکمیلی ناشی از افزایش اندازه جریان بر آورد شده است. در [۱۰] ساخت و مدل رياضي يک شنت کواکسيال با جريان کم و باند پهن دقيق مطرح شده است. بخش اصلی شنت از ۱۲ عدد SMD موازی شده تشکیل شده است. در [۱۱] حساسیت به استرس مقاومت جنس منگنین در جریان زیاد ارزیابی شد و مدلی برای عمق اثر پوستی برای محاسبه مقاومت ac ارائه شده است. در [۱۲] بررسی اجمالی برروی شنت کواکسیال انجام شده و مشخصه های موثر این سنسور برای دستیابی به پهنای باند ۲GHz معرفی شده است. هارول ویلر در [۱۳] رابطه ای برای تعیین چگالی جریان متناوب عبوری در عمق هادی بدست آورد. و بر اساس آن پارامتر عمق اثر پوستی بر اساس فرکانس جریان و جنس هادی تعریف شد. در ادامه تلاش زیادی برای تعیین مقاومت هادی در جریان متناوب انجام شده از جمله در [۱۴] فرمولاسیون اثر پوستی برای مقاومت و اندوکتانس یک

هادی استوانهای که بینهایت استوانه تو در توی موازی تقسیم شده بر اساس فرمول بسل ارائه شده است. در [1۵] نشان داده شد که با لایه لایه کردن هادی میتوان تلفات اثر پوستی را کاهش داد. در [18] محل اتصال هادی لوله ای به PCB بعنوان منبع بروز خطا معرفی شده و به رفتار حرارتی آن پرداخته است. در [۱۷] به حساسیت پهنای باند سنسور های مدول قدرت چند چیپه از چیپ های کاربید سیلیسیوم که بصورت شنت شمش گونه قرار گرفتهاند و به این طریق جریان ۴۰۰۸ با زمان خیزش ۲۶ /۰۰ اندازهگیری شده است.

در این مقاله ساختاری از شنت کواکسیال ارائه شده که هادی داخلی یکپارچهای ندارد. در این صورت مقاومت آن افزایش و اندوکتانس کاهش مییابد. روش محاسبه اندوکتانس این هادی منقطع نیز ارائه میشود. سپس الگوریتمی بر اساس روابط ارائه شده که اجزاء سنسور را برای دستیابی به پهنای باند فرکانسی دلخواه تعیین میکند. در این طراحی اثرات عمق پوستی، اندوکتانس هادی داخلی و خازن بین دو لوله و دمای هادی در نظر گرفته شده است.

۲- مقاومت شنت کواکسیال

مرسوم است یک قطعه رسانا با مقاومت اهمی کم و مشخص بعنوان شنت در مسیر جریان اصلی قرار گیرد و جریان عبوری با اندازه گیری ولتاژ کوچک دو سر آن و تقسیم نمودن بر مقاومت dc قطعه محاسبه شود. همانگونه که در مقدمه بیان شد در کاربردهای پالسی، جریان شامل مولفههای با فرکانس بسیار زیاد است و قطعه شنت در داخل میدان مغناطیسی خود جریان قرار می گیرد و علاوه بر ایجاد اندوکتانس، بواسطه اثر پوستی شدید مقدار مقاومت نیز تغییر کرده و بیش از مقاومت cb است. و اگر ولتاژ اندازه گیری شده بر مقدار مقاومت dc تقسیم شود مساوی جریان عبوری نیست. برای افزایش دقت اندازه گیری باید هم اندوکتانس حذف شود و هم اثر پوستی کم اثر شود. البته در ادامه اثر باید هم اندوکتانس محدود نمودن پهنای باند اندازه گیری بررسی می شود [۱۸].

۲-۱- ساختمان سنسور

در شکل (۱) ساختار یک مقاومت شنت کواکسیال نمایش داده شده است. جریان اصلی از ۱ وارد و از ۲ خارج می شود. در این مسیر جریان از هادی های لوله مقاومتی(لوله داخلی) که با ۳ مشخص شده و سپس از قطعه ۵ و در ادامه در خلاف جهت لوله داخلی از لوله بیرونی که با ۴ مشخص شده عبور می کند. ولتاژ خروجی بین ۶ و ۷ ظاهر می شود. در این ساختار که شبیه کابل کواکسیال است. هادی ۴ استوانه ای فلزی است لذا جریان عبوری از آن هیچ میدانی در درون خودش ایجاد نمی کند.



شکل(۱): سنسور شنت کواکسیال: ۱ و ۲ ترمینالهای مسیر جریان قدرت، ۳-لوله هادی مقاومتی داخلی(در اینجا چهار تکه)، ۴-لوله هادی بیرونی، ۵- قطعه اتصال دو لوله، ۶ و ۷-ترمینالهای اندازهگیری ولتاژ (اتصال BNC)، ۸ و ۹ عایق الکتریکی

در این صورت هادی ۳ که در درون هادی ۴ قرار دارد از میدان مغناطیسی جریان ۴ متاثر نبوده و فقط میدان مغناطیسی خودش برآن اثر دارد که اثر

پوستی را در هادی ۳ بوجود می آورد. تمامی اجزاء سنسور غیرمغناطیسی هستند. هادی ۳ نباید رسانایی در حد فلز مس داشته باشد تا دامنه ولتاژ خروجی به اندازه کافی باشد. جنس هادی ۳ در اینجا از ورق نازک منگنین است. که آلیاژی با ۸۶٪ مس، ۱۲٪ منیزیوم و ۲٪ کروم با ضریب هدایت ویژه ۱۴۰ × /۶ و ضریب گرمای ویژه (۶۰ ا/۱۶ است. این آلیاژ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد افزایش دما را بدون تغییر شکل تحمل میکند [۱۹].

در شکل (۲) شعاع داخلی و خارجی هر دو لوله شامل هادی مقاومتی (داخلی) و هادی هدایتی (بیرونی) به ترتیب با R_{in1} ، R_{ou1} و R_{ou2} نمایش داده شده است. در اینجا طول هر دو لوله با L نمایش داده شده است. ولتاژ خروجی از دو سر لوله داخلی گرفته میشود.



شکل(۲): قطر لولههای داخلی و خارجی

لوله داخلی از ۴ هادی قوسی موازی شده با ضخامت d، قطاع D=60deg و طول L تشکیل شده است. استفاده از ۴ هادی قوسی بهجای یک لوله یکپارچه سطح مقطع را کاهش می دهد که باعث افزایش مقاومت db و کاهش اندوکتانس مزاحم در هادی لوله مقاومتی داخلی می شود و چون نسبت مقاومت اهمی به اندوکتانس بیشتر می شود به حالت ایده ال که اهمی خالص است نزدیک تر شده و دقت اندازه گیری بیشتر می شود. مقاومت db این لوله از رابطه زیر بدست می آید و چون Rin1>5 است با تقریب خوبی ساده می شود.

$$R_{dc} = \frac{3L\rho}{2\pi(R_{out1}^2 - R_{in1}^2)} \approx \frac{3L\rho}{4\pi R_{in1}(R_{out1} - R_{in1})}$$
(1)

در اینجا p مقاومت ویژه هادیهای لوله داخلی است.

۲-۲- اثر پوست لوله داخلی و پهنای باند سنسور

در اثر عبور جریان متغیر از هادی لوله ی داخلی شار مغناطیسی متغیری در درون مقطع هادی و بیرون آن بوجود میآید. طبق قانون لنز این میدان مغناطیسی با عامل بوجود آورنده خودش که جریان عبوری از هادی است مخالفت میکند. شدت این میدان در سطح هادی کمتر و رو به مرکز بیشتر است لذا این مخالفت به سمت مرکز هادی بیشتر میشود. اگر جریان متناوب از هادی عبور کند و چگالی جریان در سطح و در عمق d به ترتیب با ماه و ان مشخص شود. رابطه افت چگالی شار در عمق d از سطح هادی از رابطه (۲) مشخص میشود.[۱۳].

$$\frac{i_d}{i_{d0}} = e^{-d\sqrt{j\omega_s\mu\sigma}} = e^{-(1+j)d\sqrt{\frac{\omega_s\mu\sigma}{2}}}$$
(Y)

در اینجا σ_{s} فرکانس زاویهای و μ ضریب نفوذپذیری هادیهای لوله داخلی است. بر اساس تعریف (۳) [۱۸] میتوان رابطه (۲) را بصورت (۴) بازنویسی نمود.

$$\delta = \sqrt{2\rho / (\mu \omega_s)} \tag{(4)}$$

$$\frac{i_d}{i_{d0}} = e^{-\frac{d}{\delta}} \cdot e^{-j\frac{d}{\delta}}$$
(*)

مطابق رابطه (4) چگالی شار در عمق $\delta = b$ نسبت به سطح هادی به نسبت 1/e کاهش دارد که δ عمق پوست هادی نامیده می شود. هچنین چگالی شار در این عمق یک رادیان پس فاز است [۱۳]. از رابطه (۳) عمق پوست به مقاومت ویژه و فرکانس جریان بستگی دارد. با افزایش فرکانس، عمق پوست کاهش می یابد. در این مقاله اندازه گیری جریان گذرای مدارهای باسرعت کلیدزنی بسیار سریع مد نظر است لذا جریان عبوری بصورت پالس سریع است و تغییرات شدید شار لوله داخلی را به همراه دارد. که باعث اثر پوستی قابل ملاحظه شده و عمق عبور جریان از هادی داخلی خیلی محدود می شود.

ضخامت لوله داخلی بصورت $d = R_{out1} - R_{in1}$ است. در حضور اثر پوستی، جریان فقط در سطح بین شعاعهای $R_{out1} - \delta$ و $\delta - R_{out1}$ عبور می کند. در این صورت مقاومت ac بصورت زیر است:

$$R_{ac} = \frac{3L\rho}{2\pi(R_{out1}^2 - (R_{out1} - \delta)^2)} \cong \frac{3L\rho}{2\pi R_{out1}\delta}$$
(Δ)

با جای گذاری معادله (۳) در (۵)، رابطه مقاومت ac با ω_s بصورت زیر مشخص میشود.

$$R_{ac} = \frac{3L}{2\pi R_{out1}} \sqrt{\frac{\omega_s \,\mu \,\rho}{2}} \tag{(\%)}$$

به این طریق مقاومت موثر المان سنسور جریان، تابع فرکانس است و چون مقدار مقاومت المان برابر R_{dc} نیست مقدار محاسبه شده از ولتاژ اندازه گیری شده پس از تقسیم کردن بر Rdc اندازه واقعی جریان را نشان نمیدهد. برای اینکه مقاومت لوله مقاومتی ثابت و برابر مقاومت dc باشد لازم است اثر عمق پوستی حذف و یا به حد ناچیز برسد. بر اساس آنچه در روابط (۲) الی (۴) بیان شد لازم است ضخامت لوله داخلی به اندازه کافی از δ کوچک تر باشد تا نقش اثر عمق پوستی بر مقاومت ناچیز باشد. برای این منظور هرچقدر فرکانس جريان بيشتر شود چون عمق پوست كمتر مىشود بايستى ضخامت لوله داخلى نازکتر شود. نازک شدن زیاد هادی لوله داخلی ضمن محدودیتهای تکنولوژی باعث کاهش سقف تحمل انرژی تلف شده در آن می شود. به این طریق برای دامنه جریان و یا پهنای پالس مجاز محدودیت ایجاد می کند. مطابق رابطه (۳) اگر مقاومت ویژه هادی لوله داخلی بیشتر باشد برای یک فرکانس مشخص، عمق پوست بیشتر شده و میتوان برای همان نتایج ضخامت لوله داخلی را بیشتر انتخاب نمود. به همین منظور در چنین کاربردهایی نباید از هادی مس استفاده نمود. در اینجا از جنس منگنین استفاده شده که مقاومت ویژه آن ۸۸/۸۴ برابر مقاومت ویژه مس است. این افزایش مقاومت باعث می شود برای جريان مشخص اندازه گيري شده دامنه ولتاژ خروجي بيشتر باشد كه احتمال تاثیر نویز را کاهش میدهد.

چنانچه انتخاب ضخامت برای حذف اثر پوستی صحیح باشد چون اثر پوستی وجود ندارد، رابطه (۶) برای مقاومت ac صادق نیست و در تمامی محدوده پهنای باند مقداریکه از رابطه (۶) برای مقاومت ac محاسبه شود به اشتباه کوچکتر از مقاومت dc خواهد بود. به عبارتی در یک ماده مقاومتی خیلی نازک، اثر پوست تنها در فرکانس بسیار زیاد آشکار میشود و فرکانسی که در آن عمق پوست با ضخامت ماده برابر شود انتهای محدوده مجاز فرکانسی آن ماده با آن ضخامت است که پهنای باند را تعیین میکند. لذا بر اساس جنس و ضخامت لوله داخلی سنسور جریان، پهنای باند آن مطابق رابطه (۲) مشخص میشود. با توجه به مشخص بودن جنس لوله داخلی برای افزایش بیشتر پهنای باند باند میتوان ضخامت لوله داخلی را کمتر نمود. عوامل دیگری نیز بر پهنای باند

سنسور موثر هستند. این عوامل در ادامه مطرح می شوند. در طراحی سنسور تلاش می شود آن عوامل به نحوی انتخاب شوند که محدوده فرکانس مجاز آنها بیش از ω_s باشد. به این طریق اثر پوستی تعیین کننده نهایی پهنای باند خواهد بود.

$$\omega_{\rm s} = \frac{2\rho}{\mu({\rm R}_{out1} - R_{in1})^2} \tag{(Y)}$$

۲-۳- مدار معادل سنسور

حسگر جریان چهار ترمینال دارد. دو ترمینال برای عبور جریان قدرت است که حلقه قدرت را تکمیل می کند. جریان این ترمینالها از هر دو هادی لولهای عبور می کند و مدار معادلی شبیه کابل کواکسیال دارد که از مقاومت دو لوله و اندوکتانس Lco تشکیل می شود. دو ترمینال دیگر برای اندازه گیری ولتاژ دو سر لوله داخلی است که به کابل اسیلوسکوپ متصل می شود و حلقه اندازه گیری را تکمیل می کند. سنسور جریان در حلقه اندازه گیری فقط دارای مقاومت لوله داخلی و اندوکتانس Lm است. مدار معادل سنسور جریان وقتی به اسیلوسکوپ متصل است بصورت شکل (۳) است. اندیس n که به س



شکل(۳): مدار معادل حسگر در اتصال به اسیلوسکوپ[۱۲]

در اینجا Rm مقاومت هادی لوله داخلی است که عموماً از جنس منگنین است. R_{cu} مقاومت هادی لوله بیرونی است که اغلب از جنس مس یا آلومینیوم است. اندوکتانس L_{co} از میدان مغناطیسی جریان قدرت بوجود میآید و مشابه کابل کواکسیال از رابطه (۸) محاسبه میشود[۱۲] و در صورت نیاز میتوان مقدار این اندوکتانس را مطابق آنچه در ادامه آورده میشود کاهش داد.

$$L_{co} = \frac{\mu L}{2\pi} L_n(\frac{R_{in2}}{R_{out1}}) \tag{(A)}$$

۲-۱۰–محاسبه اندوكتانس لوله داخلى

$$\omega_{s} << \frac{R}{L_{mn}} \tag{9}$$

برای لولههای مقاومتی با ضخامت بسیار کم عموماً فرکانس گوشه ناشی از اثر عمق پوستی کمتر از فرکانس فوق است و به این طریق پهنای باند با اثر پوستی مشخص میشود. به منظور محاسبه L_m، برش طولی دو لوله در شکل (۴) نمایش داده شده است. در این شکل، پنج ناحیه به ترتیب با حروف A الی

E مشخص و نامگذاری شده است. فواصل بین چهار هادی تشکیل دهند لوله داخلی به نحوی است که توزیع میدان تقریباً با هادی یکپارچه یکسان است. برای اطمینان از یکسان بودن، میتوان از طریق شبیهسازی در نرم افزارهایی مانند ماکسول استفاده کرد. به این طریق تعداد و ابعاد هادی به نحو مناسب انتخاب میشوند. برای تمامی پنج ناحیه نام برده، شدت میدان مغناطیسی در فاصل x از مرکز لوله ها از رابطه $I = H_x.dl$ بصورت زیر محاسبه میشود. در اینجا ال مماس بر دایرهای به شعاع x از مرکز است و I جریان عبوری است.



شکل(۴): برش هادیهای لولهای و نواحی

$$H_A = H_E = 0 \tag{(1)}$$

$$H_B = \frac{I}{2\pi x} \frac{x^2 - R_{in1}^2}{R_{out1}^2 - R_{in1}^2} \tag{11}$$

$$H_C = \frac{I}{2\pi x} \tag{11}$$

$$H_D = \frac{I}{2\pi x} (1 - \frac{x^2 - R_{in2}^2}{R_{out2}^2 - R_{in2}^2}) \tag{17}$$

H_A الى H_B به ترتيب شدت ميدان پنج ناحيه A الى E هستند. چون جنس H_B تمام نواحى غيرمغناطيسى است $\mu_{0}H_{B} = a_{0}$ مىباشد از جمله $B_{B} = \mu_{0}H_{B}$ است. شدت ميدان مغناطيسى B_B را مىتوان به دو بخش B_B و B_B تجزيه نمود. B_B و گالى شار ناحيه B ناشى از ميدان مغناطيسى بيرون لوله داخلى است يعنى چگالى شار ناحيه B ناشى از ميدان مغناطيسى داخل شعاع است. بيرون شعاع R_{out1} است و B_B ناشى از ميدان مغناطيسى داخل شعاع B_{B0} است. چون ميدان مغناطيسى نواحى خارج شعاع R_{out1} بر ناحيه B اثرى ندارد. B_{B0} -0 و B_B=B_B است.

اگر شار در ناحیه B که فقط به ازاء جریان هادی داخلی بوجود آمده و نقطه اتصال سیم در نقطه a را احاطه کرده را با Φ_{BIa} نشان دهیم آن گاه:

$$\Phi_{BIa} = \int_{R_{in1}}^{R_{out1}} B_{BI} dx = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[1 - \frac{2R_{in1}^2}{R_{out1}^2 - R_{in1}^2} L_n(\frac{R_{out1}}{R_{in1}}) \right] \quad (15)$$

چنانچه شار پیوندی متوسط در ناحیه B فقط به ازاء جریان هادی درونی را با Φ_{BIB} نشان دهیم آنگاه:

$$\begin{split} \Phi_{BIB} &= \frac{1}{\pi (R_{out1}^2 - R_{in1}^2)} \int_{R_{in1}}^{R_{our1}} 2\pi x dx \int_{x}^{R_{our1}} B_{BI} dx \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{R_{out1}^2 - 3R_{in1}^2}{2(R_{out1}^2 - R_{in1}^2)} + \frac{2R_{in1}^4}{(R_{out1}^2 - R_{in1}^2)^2} L_n(\frac{R_{out1}}{R_{in1}}) \right] \end{split}$$

به این طریق اندوکتانس دو سر ترمینال ولتاژ خروجی بصورت رابطه (۱۶) است.

$$L_{mn} = \frac{L}{I} (\Phi_{BIB} - \Phi_{BIa}) = \frac{L\mu_0}{4\pi} [\frac{(R_{out1}^2 - 3R_{in1}^2)}{2(R_{out1}^2 - R_{in1}^2)} + \frac{2R_{in1}^2 R_{out1}^2}{(R_{out1}^2 - R_{in1}^2)^2} Ln(\frac{R_{out1}}{R_{in1}}) - 1]$$
(19)

از آنجا که R و L_{mn} هر دو با طول سنسور متناسب هستند تغییر طول سنسور در شرط (۹) بی اثر است.

۵-۲- خازن شنت کواکسیال بین دو لوله

در شکاف خالی بین هادیهای لوله داخلی و لوله خارجی، خازنی وجود دارد که از رابطه (۱۷) تعیین میشود.

$$C_{co} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{L_n(\frac{R_{in2}}{R_{out1}})}$$
(1V)

در اینجا ${}^{\mathcal{S}}$ ثابت گذردهی خلا است. هرچه فاصله بین دو لوله بیشتر باشد این ظرفیت بزرگتر می شود. افزایش این ظرفیت، بهره خروجی در فرکانس های خیلی زیاد را تضعیف می کند. برای حذف این اثر بر پهنای باند سنسور بایستی شرط (۱۸) برقرار باشد به عبارتی فرکانس گوشه $I/RC_{\rm co}$ نیز به اندازه کافی بزرگتر از ${}^{\mathcal{B}}$ باشد. اگر در این شرط از رابط (۱۷) استفاده شود می توان شرط را بصورت رابطه (۱۹) بازنویسی نمود.

$$\frac{1}{RC_{co}} >> \omega_s \tag{1A}$$

$$\frac{L_n(\frac{K_{in2}}{R_{out1}})}{2\pi\varepsilon_0 LR} \gg \omega_s \rightarrow L_n(\frac{R_{in2}}{R_{out1}}) \gg 2\pi\varepsilon_0 LR\omega_s \quad (19)$$

$$\rightarrow R_{in2} \gg R_{out1}e^{2\pi\varepsilon_0 LR\omega_s}$$

چون $_{0}^{0}$ عدد بسیار کوچکی است در محدوده طراحی سنسور جریان، عبارت $_{0}^{2} 2\pi c_{0} LR \omega_{s}$ بسیار کوچک بوده و $_{1} = e^{2\pi c_{0} LR \omega_{s}}$ است و به جای شرط رابطه (۱۸) می توان از شرط R_{in2} به اندازه کافی بزرگتر از R_{out1} استفاده نمود. در صورت بروز محدودیت در قطر سنسور می توان با کاهش طول سنسور (L) هم R و هم C_{co} را کاهش داد و فرکانس گوشه $1/RC_{co}$ به اندازه کافی بزرگ نمود.

ضمناً طول سنسور باید در محدودیتهای ولتاژ خروجی صدق کند. برای این منظور لازم است حداکثر جریان ورودی سنسور به نحوی باشد که ولتاژ خروجی سنسور از ۲۰۰۷ ولت (ولتاژ تحمل اسیلوسکوپ) کمتر باشد. همچنین برای کمترین مقدار جریان معنی دار ورودی، ولتاژ خروجی سنسور از حداقل ولتاژ قابل اندازه گیری (برای مثال ۱۳۷۷) بیشتر باشد. مطابق (۱) طول سنسور با مR متناسب است. البته به منظور یکنواخت بودن میدان درون لوله بهتر است. یکنواختی توزیع میدان در نرم افزار ارزیابی شود معمولا لازم است طول لوله از ۵۰ میلیمتر بزرگتر باشد.

$$1.5R_{dc}I_{\max} < 300[v] \tag{(7.)}$$

$$(R_{dc} I_{\min} > 1[mv]) and (L > 50[mm])$$
 (71)

برای این طرح ابعاد اصلی سنسور مقادیر کمیتها در جدول (۱) آورده شده است. بر اساس روابط(۳) الی (۱۷) مقادیر پارامترهای این سنسور محاسبه و در جدول (۲) نمایش داده شده است.

جدول (1): ابعاد سنسور جريان

مقدار [mm]	كميت
۲۰۰	L
۲۸/۷	2*R _{in1}
۲٩/۶	2*R _{out1}
٩١	2*R _{in2}
٩٧	2*R _{out2}

جدول(۲): پارامترهای سنسور جریان

واحد	مقدار	كميت
[mm]	•/8149	δ
[Rad/s]	۱/۱۷۳×۱۰ ^۷	ω_s
[s]	$Y/Y \times^{\Lambda-} 1$ ·	t _r
[Ω]	۱/۱× ^{۲-} ۱۰	$R_{\rm dc}$
[H]	۴/۴٩× ^{۸-} ۱۰	$L_{ m co}$
[H]	-۲/•۵۸× ^{۱۰-} ۱•	$L_{ m mn}$
[F]	۹/٩ • ٧ × ^{١ ۲-} ۱ •	$C_{ m co}$

برای مقادیر مشخص شده در جدول (۲) شرط، b به اندازه کافی کوچکتر از δ ، برقرار است. همچنین مقدار محاسبه شده از رابطه (۶) کوچکتر از مقاومت dc است که صحت شرط را تایید می کند. همچنین شرط رابطه (۹) برقرار است و L_{mn} پهنای باند سنسور را محدودتر نکرده و پهنای باند سنسور مطابق ω_s در جدول (۲) است.

۶-۲-دمای هادی مقاومتی شنت کواکسیال

جنس هادی لوله داخلی از آلیاژ منگنین است و تا دمای بیش از ۳۰۰ درجه را به راحتی تحمل می کند. اما مطابق منحنی شکل (۵) برای اینکه مقدار مقاومت تغییر محسوسی نداشته باشد بهتر است حداکثر تغییر دما در حد ۱۰۰ درجه سانتیگراد محدود شود. تغییر دمای لوله داخلی به انرژی تلف شده در آن وابسته است. انرژی تلف شده نیز به مقاومت هادی و شکل پالس جریان بستگی دارد. سطح زیر شکل پالس جریان، عامل موثر در تولید تلفات است که به نوعی در ارتباط با دامنه و پهنای پالس است. عموماً در فرکانسهای کم، پهنای پالسها خیلی بیشتر بوده و در افزایش سطح زیر منحنی پالس بسیار موثرند.



شکل(۵): درصد تغییرات مقاومت منگنین نسبت به دما

به نحوی که بیشترین تلفات در فرکانسهای کم رخ میدهد. لذا برای سنسوری که برای پالسهای از مرتبه میلی ثانیه تا نانو ثانیه بهکار میرود. پالسهای مرتبه میلی ثانیه از نظر حرارتی باید ارزیابی شوند.

جرم هادی لوله داخلی از رابطه زیر محاسبه می شود که در آن $\Delta T = E_{mm} \, / \, m_{mm} C_{mm}$

$$m_{mn} = \frac{4}{3}\pi L \rho_{mn} R_{in1} (R_{out1} - R_{in1})$$
(77)

Cmn اگر انرژی تلف شده هادی لوله داخلی با Emn و گرمای ویژه آن با $\Delta T = E_{mn} / m_{mn} C_{mn}$ است و با مشخص شود. تغییر دمای آن بصورت $\Delta T = E_{mn} / m_{mn} C_{mn}$ جایگذاری جرم بصورت زیر میباشد.

$$\Delta T = 3E_{mn} / (4\pi L\rho_{mn}R_{in1}(R_{out1} - R_{in1})C_{mn}) \quad (\gamma\gamma)$$

چنانچه با رعایت شرط $\delta << b$ برای فرکانسهای کمتر از w_s اثر پوستی جذف شده باشد. مقاومت لوله داخلی برابر R_{dc} است. اگر انتگرال مجذور جریان حذف شده باشد. مقاومت لوله داخلی برابر R_{dc} است. اگر انتگرال مجذور جریان بصورت $I^2 = \int i^2 dt$ با استفاده از رابطه (۱)، تغییر دما بصورت (۲۴) نیز بیان می شود.

$$\Delta T = 9\rho I^2 / (16\pi^2 \rho_{mn} R_{in1}^2 (R_{out1} - R_{in1})^2)$$
 (Yf)

مطابق رابطه (۲۴) طول سنسور بر دمای لوله داخلی بی اثر است اما ضخامت و قطر داخلی لوله داخلی بر افزایش دمای آن تاثیر گذار هستند. ضخامت این لوله توسط پهنای باند سنسور تحمیل می شود لذا در صورت نیاز می توان با افزایش قطر داخلی لوله داخلی، میزان افزایش دما را تا حد مجاز کاهش داد. در جدول (۳) تغییرات دمای هادی برای چند پالس تخت آورده شده است.

$\Delta T[C^0]$	پهنای	دامنه
	پالس [µs]	پالس [kA]
۹/۵	1	۴
٨۵	1	١٢
1	1	١٣
1	1	1⁄4
• / ٧ ٢	١	۳۵

جدول(۳): تغییر دما برای پالسهای مختلف

در اینجا انتخاب طول سنسور یک درجه آزادی است که بر دمای سنسور اثر ندارد، چون با کاهش طول، مقدار مقاومت و انرژی تلف شده نیز با همان نسبت کاهش داده میشود. اما کاهش طول بر کاهش $C_{\rm oo}$ ، $C_{\rm oo}$ و مقاومت موثر است. قبلا بیان شد که کاهش $C_{\rm co}$ و $L_{\rm co}$ مفید هستند اما کاهش مقاومت dbمقدار ولتاژ خروجی سنسور را کاهش میدهد. همچنین طول سنسور نباید از حدی کمتر شود که میدان مغناطیسی در طول لوله غیریکنواخت شود.

۳- مراحل طراحی سنسور جریان

ابتدا بر اساس شکل پالس جریان مورد اندازه گیری بایستی فرکانس و مقدار R_{in1} ابتدا بر اساس شکل پالس جریان مورد اندازه گیری بایستی فرکانس و مقدار R_{in1} الا $I^2 = \int I^2 dt$ پیشنهاد می شود. سپس مطابق فلوچارت شکل (۶) مقدار ۲۵۰۱ بر اساس پهنای باند تعیین می شود. اگر شرط (۹) برقرار نبود [mm] ۲۰۰۸ از ۲۵۰۰ کسر می شود و دو باره شرط (۹) بررسی می شود و انقدر حلقه تکرار می شود تا شرط برقرار شود. در این حالت اگر حلقه تکرار نشده باشد مقدار ۵ تغییر نکرده و پهنای باند شود. در این حالت اگر حلقه تکرار شده باشد مقدار ۵ تغییر نکرده و پهنای باند شود. در این حالت اگر حلقه تکرار شده باشد مقدار ۵ تغییر نکرده و پهنای باند می مود. در این حالت اگر حلقه تکرار شده باشد چون ۵ کوچکتر شده پهنای باند بیشتر شده است. اما اگر تکرار شده باشد چون ۵ کوچکتر شده و سپس با ۱۰۰ درجه سانتیگراد مقایسه می شود. اگر کم تر باشد از (۲۷) محاسبه شده و سپس با ۱۰۰ درجه سانتیگراد مقایسه می شود. اگر کم تر باشد از (۷) پهنای باند جدید محاسبه می شود. در غیر این صورت انتخاب اولیه ایم از (۷) پهنای باند جدید محاسبه می شود. در غیر این صورت انتخاب اولیه ایست به درا مور این محاله می شود. در غیر این صورت انتخاب اولیه ایم ایم ایند خون ۵ کو می مور در محاسبه شده و می مور این در محاسبه شده و می مور محاسبه در محاسبه شده ای محاله می شود. اگر کم تر باشد از (۷) پهنای باند جدید محاسبه می شود. در غیر این صورت انتخاب اولیه ایم ایم ایم در خیر این صورت انتخاب اولیه ایم ایم در خون ۵ کو می مور این صورت انتخاب اولیه ایم می شود. در غیر این صورت انتخاب اولیه ایم می شود. در غیر این صورت ایم در می ایم در می ایم در می این صورت ایم در می ایم در می می مود ایم در می ایم در می ایم در می می مود.

شده و به گام اول بر می گردد. در نهایت پس از تایید شرط دما، مقدار اولیه R_{in2} ، ۱/۵ ، برابر R_{out} انتخاب می شود.



شکل(۶) فلوچارت طراحی سنسور شنت کواکسیال

از روابط (۱)، (۲۰) و (۲۱) مقدار حداقل و حداکثر مجاز L محاسبه می شود. و شرط (۱۸) ارزیابی می شود. اگر برقرار نبود R_{in}2 به اندازه [mm] ۰/۰۰۵ بزرگتر شده و مجددا شرط ارزیابی می شود. تا شرط (۱۸) برقرار شود. در انتها بر اساس ضخامت لوله خارجی سنسور که اولا استحکام لازم را داشته باشد و ثانیاً بیشتر از b باشد تا جریان را تحمل کند. مقدار Rout2 تعیین می شود.

۴- تست آزمایشگاهی

روش الگوریتم طراحی سنسور ارائه شده وابسته به زمان خیزش پالس نیست و تاجایی که تکنولوژی نازک کردن هادی داخلی مقدور باشد می توان پهنای باند سنسور را افزایش داد. از جدول(۱) مشخص است برای نمونه ۳۵ به هادی با ضخامت ۴۵mm/۰ نیاز است. البته این سنسور مطابق جدول(۳) دارای محدودیتهای دامنه و پهنای پالس است. بطور مشابه نتایج طراحی سنسور ns در جدول (۴) آورده شده که به هادی با ضخامت ۰/۰۲۵mm دامنه و پهنای مشابه می توان بر اساس محدودیت افزایش دما، محدودیتهای دامنه و پهنای پالس مورد اندازه گیری را محاسبه نمود. از آنجا که برای تست سنسور جریان فقط دستگاه تست برای نمونه ۲۵ در اختیار بود در این مرحله نمونه ۱۵ ساخته شد و در ادامه نتایج تست عملی و صحت سنجی برای این نمونه ارائه شده است. تصویر سنسور ساخته شده با مشخصات مندرج در جدول (۱) و ساختاری

مشابه شکل (۱) در شکل (۶) نمایش داده شده است. -

ستاپ آزمایش در شکل (۸) نمایش داده شده است. دو آزمایش با دو پالسی که پهنای متفاوت دارد انجام شده است. نتایج دو آزمایش با نمونه استاندارد مطابقت داشته است.



شکل(۷): تصویر سنسور جریان



شکل (۸): ستاپ تست سنسور جریان

ابتدا از یک پالس با دامنه [A]۱۴۶ و پهنای [ms] ۲/۵ ابرای آزمایش سنسور استفاده شد. مطابق شکل (۹) تنظیمهای اسیلوسکوپ ۱۷/div و *μs / div* ۵۰۰ است. ولتاژ خروجی [۷]۱/۶۰۵ ولت با زمان [ms] ۲/۵[ms است و با استفاده از مقاومت cc، جریان اندازه گیری شده [۸]۱۴۵/۹۱ می باشد.

در آزمایش دوم از پالس استاندارد ۸/۲۰μ۶ با دامنه [kA]۲ استاندارد استفاده شده پهنای پالس ۳۲μ۶ است. این پالس بصورت همزمان با دو سنسور اندازهگیری شده است.



شکل(۹): خروجی تست اول

روب اول به حسگر کالیبره از نوع روکوفسکی شرکت PEM مدل CWT مدل PEM مدل PEM مدل 2008 متصل است و پروب دوم به شنت مقاومتی کواکسیال متصل شده و خروجی آنها در شکل (۱۰) به ترتیب با حروف a و b نمایش داده شده است. مطابق شکل (۱۰) تنظیم زمانی اسیلوسکوپ viv/div و تنظیم پروب دوم ۵۷/div است. ولتاژ خروجی شنت مقاومتی کواکسیال [V] ۲۲ با پهنای ۳۲µs است. این دامنه معرف جریان [A] ۲۰۰۰ است. ولتاژ خروجی سنسور روکفسکی نیز [V]۰۲ با پهنای پالس ۳۴µs است. سنسور رکوفسکی نیز دامنه جریان را نیز [V]۰۲ با پهنای پالس ۳۴µs است. سنسور رکوفسکی نیز دامنه جریان را نشان نمی دهد. علاوه بر دقیق نبودن شکل، ۲µs در سنجش پهنای پالس خطا دارد. بنابر این سنسور جریان پیشنهادی پهنای پالس را دقیقتر از حسگر رکوفسکی اندازه گیری نموده است.



شکل(۱۰): خروجی تست دوم

برای اندازه گیری جریانهای پالسی با زمان خیزش از مرتبه نانوثانیه می توان از طرح سنسور جریان زیر استفاده نمود. در این طرح ضمن کاهش طول سنسور، سایر ابعاد سنسور کوچکتر است. ضخامت هادی لوله داخلی ۱۰/۰۵mm منابعاد اصلی سنسور و مقادیر کمیتها در جداول (۴) و (۵) آورده شده است.

از آنجا که ماهیت این اندازه گیری از نوع فرکانس زیاد است. برای انتقال سیگنال اندازه گیری به اسیلوسکوپ بعنوان مثال از کابل کواکسیال ۷۵ اهم به ترمینال ۷۵ اهم اسیلوسکوپ استفاده می شود تا مانع از بازتاب سیگنال بین کابل و اسیلوسکوپ شود. همچنین باید مقاومت اهمی لوله داخلی سنسور خیلی کوچکتر از ۷۵ اهم باشد تا بازتاب بین سنسور و کابل وجود نداشته باشد. مراجع

[۱] پ. پورمحمدیان، م. ک. عدالتیان، " بررسی رفتار عایقی روغن معدنی در ولتاژ فرکانس قدرت با حضور نانو لولههای کربنی"، مجله برق مهندسی تبریز، دوره ۴۴ شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳.

[7] ا. عزیزنیا؛ م. ا. حجازی، " مدلسازی بار مولدهای توان پالسی در کاربرد

الکتروپوریشن با استفاده از طیفسنجی امپدانس سلولهای نرمال و سرطانی

ریه انسان" مجله برق مهندسی تبریز، دوره ۵۲ شماره ۱، بهار ۱۴۰۱. [3] M. Hollander, "High frequency oscillations measured with high bandwidth current sensors at low current", Hollander Reserch delivers the power to test, pp. 1–19, 11 April 2014.

[4] P. Ieee and S. Energy, "4-2013 IEEE Standard for High-Voltage Testing Techniques IEEE Power and Energy Society", I IEEE Power and Energy Society . May. 2013.

[5] C. M. Johnson and P. R. Palmer, "Current measurement using compensated coaxial shunts", IEE Proceedings Science Measurement and Technology, Vol. 141, No. 6, pp. 471–480, 1994.

[6] T. Kawamura, E. Haginomori, Y. Goda, and T. Nakamoto, "Recent developments on high current measurement using current shunt", IEEJ Transaction Electric Electronic Engineering, Vol. 2, No. 5, pp. 516–522, 2007.

[7] P. F. Baranov, V. N. Borikov, E. I. Tsimbalist, "Measurement of the Current Transfer Function for Power Transducers of Current to Voltage", Applied Mechanics and Materials, Vol. 75, No.6, pp. 615-621, 2015.

[8] A. Milicevi, P. Mostarac, "Simulated Annealing Characterization of Equivalent Circuit Models for Precision Coaxial Current Shunts", 2nd International Colloquium on Smart Grid Metrology, Split, Croatia, April 9-12, 2019.

[9] E.V. Bedareva, E.I. Tsimbalist, A.A. Epifanova, N.A. Gavrilenko, "Consideration of Complementary Error During Design of the Alternating Current Coaxial Shunts", International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems, 01-04 December 2015.

[10] M. Malinowski, K. Kubiczek, M. Kampik, K. Musioł, M. Grzenik, K. Dudzik and W. Domański, "A Precision Coaxial Low-Current Shunt with Improved Mathematical Model", Proceedings of the 13th International Conference MEASUREMENT, Smolenice, Slovakia, 17-19 May 2021.

[11] W. F. PRAEG, "Stress Sensitivity Of Manganin Resistor in High-Current Precision Coaxial Shunt", IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 5, NO. 4, DECEMBER, 1966.

[12] W. Zhang, Z. Zhang, F. Wang, "Review and Bandwidth Measurement of Coaxial Shunt Resistors for Wide-Bandgap Devices Dynamic Characterization", IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 29 September – 03 October, 2019.

[13] H. A. Wheeler, "Formulas for the Skin Effect", IEEE Proceedings of the I.R.E., Vol. 30, No. 9, pp. 412–424, Sebtember, 1942.

[14] Omar M. O. Gatous, and J. Pissolato Filho, "A New Fomulation for Skin-effect Resistance and Internal Inductance Frequency-Dependent of a Solid Cylindrical Conductor", IEEE Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, 2004.

[15] A. M. CLOGSTON, 'Reduction of Skin Effect Losses by the Use of Laminated Conductors,' The Bell System Technical Journal, July, 1951.
[16] H. Lutzen, V. Polezhaev, K. B. Rawal, K. Ahmmed, T. Huesgen, N. Kaminski, "Temperature Compensated M-Shunts for Fast Transient and Low Inductive Current Measurements", 12th International Conference on Integrated Power Electronics Systems, Berlin, Germany, 15-17 March 2022.

[17] C. D. New, A. N. Lemmon and B. T. DeBoi, "Sensitivities in High-Bandwidth, High-Current Shunt Measurements for Silicon-Carbide Multi-Chip Power Modules", IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, Houston, TX, USA, 20-24 March 2022.

[18] K. Schon, "High Impulse Voltage and Current Measurement Techniques", Springer International Publishing Switzerland 2013.[19] G. Ventura, S. Giomi, "Thermal Conductivity of Manganin Between

10 mK and 54 mK", Int. J. Thermophys, Vol. 38, pp 1-5, 2017.

جدول (۴): ابعاد سنسور جریان

مقدار [mm]	كميت
٧٠	L
٨/• ۵	2*R _{in1}
٨/١	2*R _{out1}
17/1	2*R _{in2}
۱۲/۷	2*R _{out2}

ان	جري	سنسور	مترهای	پارا	:(۵	جدول(
----	-----	-------	--------	------	-----	-------

واحد	مقدار	کمیت
[mm]	•/•1944	δ
[Rad/s]	۲/۶۳۹×۱・ ^۹	ω_s
[s]	1/T×''-1 •	t _r
$[\Omega]$	۲/• ۷۹× ^{۱-} ۱ •	$R_{\rm dc}$
[H]	۵/۶۷۶× ^{۹-} ۱۰	$L_{ m co}$
[H]	-1/YFT× ¹¹⁻ 1 •	$L_{ m mn}$
[F]	9/8·&× ¹¹⁻ 1·	$C_{ m co}$

۵- نتیجهگیری

استفاده از چند هادی موازی به جای هادی لوله داخلی سنسور شنت کواکسیال میتواند مقاومت اهمی لوله را افزایش و اندوکتانس را کاهش دهد. این افزایش نسبت R/L باعث میشود سهم ولتاژ اهمی خالص به ولتاژ اندوکتانس مزاحم بیشتر شده و دقت محاسبه جریان از ولتاژ اندازه گیری شده را افزایش دهد. همچنین افزایش مقاومت به تحقق شرط رابطه (۹) کمک میکند. به این طریق محدودیت پهنای باند کمتر می شود.

همچنین برای کاهش اثر عمق پوستی بایستی ضخامت لوله هادی داخلی به اندازه کافی کوچکتر از δ انتخاب نمود. و برای حذف اثر اندوکتانس هادی داخلی بایستی شرط رابطه (۹) برقرار باشد. و بر اساس روشی که در این مقاله برای محاسبه تحلیلی مقاومت و اندوکتانس لوله داخلی منقطع ارائه شد. میتوان با انتخاب مناسب اجزاء سنسور به تحقق این شرط کمک نمود.

خازنی بین دو لوله هادی داخلی و بیرونی با مقاومت هادی داخلی فیلتر مرتبه اولی بوجود میآورد که بهره خروجی در فرکانسهای زیاد را کاهش میدهد با محاسبه فرکانس گوشه فیلتر، شرط لازم برای حذف این اثر در محدوده باند فرکانسی سنسور تعیین میشود. برای محدوده علاو ns ملاحظه شد اثر عمق پوستی در محدود کردن باند فرکانس سنسور به مراتب بیش از دو عامل دیگر است.

مطابق رابطه (۲۴) طول سنسور بر دمای لوله داخلی بی اثر است اما ضخامت و قطر داخلی لوله داخلی بر افزایش دمای آن تاثیر گذار هستند. ضخامت این لوله توسط پهنای باند سنسور تحمیل می شود لذا در صورت نیاز می توان با افزایش قطر داخلی لوله داخلی، میزان افزایش دما را تا حد مجاز کاهش داد.

الگوریتمی طراحی سنسور بر اساس مشخصات پالس مورد اندازهگیری ارائه شد و نتایج نمونه ساخته شده صحت طراحی را تایید میکنند.